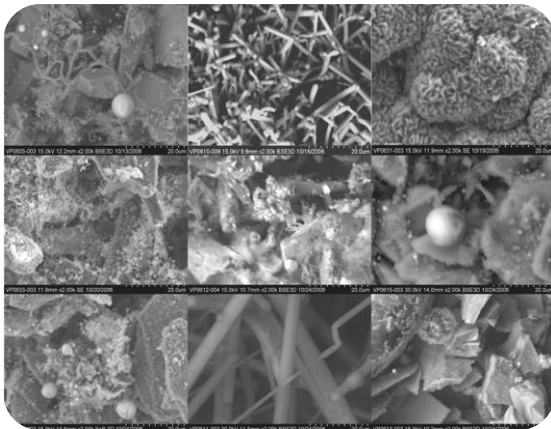


Obtención de oxinitruro y/o nitruro de silicio

Este método permite producir oxinitruro de silicio y/o nitruro de silicio de manera selectiva, obteniéndose compuestos de gran pureza ya sea en polvo, reforzamiento y/o recubrimientos, empleando recursos sólidos fluorados de silicio.

VENTAJAS



- Se ahorra energía gracias al aprovechamiento de los gradientes térmicos.
- Facilita la formación de nitruros, debido a que las especies reactantes se encuentran disociadas y promueven la formación selectiva de oxinitruro de silicio y/o nitruro de silicio.
- Se reducen los tiempos y las temperaturas del procesamiento.

APLICACIONES

Industria microelectrónica, fabricación de circuitos integrados VLSI, dieléctricos multicapas, películas externas de pasivación, celdas solares, óptica y optoelectrónica.

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

Lista para transferencia y comercialización.